# Article information:

Controllable One-Pot Growth of MoSe2/WSe2 Lateral and Vertical Heterostructures by Facile Chemical Vapor Deposition  
<https://pubs.acs.org/doi/epdf/10.1021/acsaelm.3c00652>

# Article summary:

1. 本研究开发了一种简便的化学气相沉积（CVD）方案，用于在无定形SiO2/Si基底上制备大面积和单晶WSe2/MoSe2异质结构。

2. 通过使用定制的温度曲线和引入H2流，以及在生长基底下方将过渡金属前体放置在两侧以生长横向异质结构，或将Mo源与W源堆叠以生长纵向异质结构，实现了不同二维过渡金属硫族化合物材料的可控横向（或纵向）外延生长。

3. 这种一步法和简便的CVD外延策略可能为制备大面积和高质量的横向和纵向二维过渡金属硫族化合物异质结构铺平道路，这对电子学和光电子学具有重要意义。

# Article rating:

Appears strongly imbalanced: The article is written in a biased or one-sided way, and the information it provides is not trustworthy enough to be considered a reliable source. You should consult other sources to find reliable information on the presented issues.

# Article analysis:

对于上述文章的详细批判性分析如下：

1. 潜在偏见及其来源：文章没有明确提到作者的研究背景和利益关系，这可能导致潜在的偏见。此外，文章中没有提及其他相关研究或观点，也没有进行对比分析，这可能导致信息的片面性。

2. 缺失的考虑点：文章没有讨论可能存在的风险或局限性。例如，它没有探讨材料生长过程中可能出现的污染问题，也没有讨论材料在实际应用中可能遇到的稳定性和可靠性问题。

3. 无根据的主张：文章声称所开发的化学气相沉积方法可以实现大面积和高质量的二维过渡金属硫族化合物异质结构的制备，但并未提供充分的证据来支持这一主张。缺乏详细的实验数据和结果以及对比实验来验证该方法与其他方法之间的差异。

4. 未探索的反驳：文章未涉及任何可能存在争议或反对意见，并且未对已有研究结果进行评估或解释。这种单方面呈现可能导致读者对该方法和结果产生误导性的印象。

5. 宣传内容和偏袒：文章中使用了一些宣传性的词语，如“容易”、“大面积”和“高质量”，这可能会给读者留下过于乐观的印象。此外，文章未提及任何潜在的局限性或挑战，这可能导致对该方法的过度宣传。

总体而言，上述文章存在信息片面性、缺乏充分证据支持、未探索反驳观点等问题。为了提高其可信度和科学价值，作者应该更全面地讨论研究结果，并考虑到可能存在的风险和局限性。此外，与其他相关研究进行对比分析也是必要的。

# Topics for further research:

* 作者研究背景和利益关系
* 其他相关研究或观点
* 材料生长过程中的污染问题
* 材料的稳定性和可靠性问题
* 实验数据和结果的详细性
* 与其他方法的对比实验

# Report location:

<https://www.fullpicture.app/item/250d7315b4f85c16f2e1346bf37cc384>